

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
24. Dezember 2003 (24.12.2003)

PCT

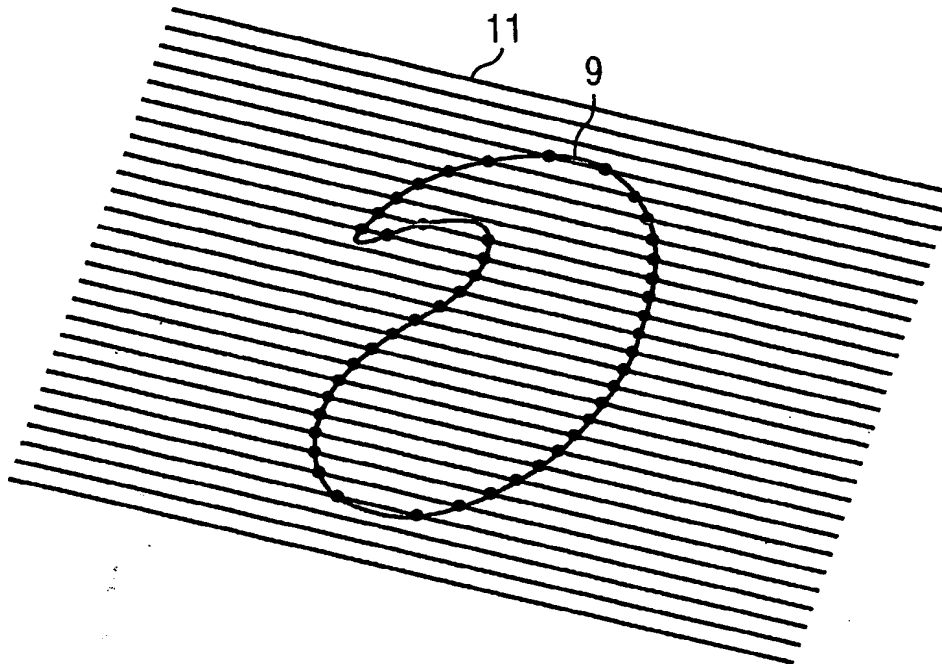
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 03/106189 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: B42D 15/10, G02B 5/18, G03H 1/30
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP03/06081
- (22) Internationales Anmeldedatum:  
10. Juni 2003 (10.06.2003)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:  
102 26 115.6 12. Juni 2002 (12.06.2002) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): GIESECKE & DEVRIENT GMBH [DE/DE]; Prinzregentenstrasse 159, 81677 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KAULE, Wittich [DE/DE]; Lindacher Weg 13, 82275 Emmering (DE).
- (74) Anwalt: KLUNKER, SCHMITT-NILSON, HIRSCH; Winzererstrasse 106, 80797 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING A GRATING IMAGE, GRATING IMAGE AND SECURITY DOCUMENT

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM ERZEUGEN EINES GITTERBILDES, GITTERBILD UND SICHERHEITSDOKUMENT



(57) Abstract: The aim of the invention is to produce a grating image for a security document. To this end, a contour (9) is filled with hatching (11) in a drawing program, grid co-ordinates are calculated from the points of intersection of the hatching (11) with the contour (9), and the data records thus produced are supplied to a lithography machine.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

**Veröffentlicht:**

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

**(57) Zusammenfassung:** Zum Erzeugen eines Gitterbildes für ein Sicherheitsdokument wird vorgeschlagen, in einem Zeichenprogramm eine Umrisslinie (9) mit Schraffurlinien (11) zu füllen, aus den Schnittpunkten der Schraffurlinien (11) mit der Umrisslinie (9) Gitterkoordinaten zu berechnen und die so erzeugten Datensätze einer Lithographiemaschine zuzuführen.

Verfahren zum Erzeugen eines Gitterbildes, Gitterbild und  
Sicherheitsdokument

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erzeugen eines ein Gittermuster aufweisenden Gitterbildes, bei dem mit Hilfe einer Schreibvorrichtung das Gittermuster auf der Oberfläche eines Substrats ausgebildet wird.

Die Erfindung betrifft ferner ein Gitterbild und ein Sicherheitsdokument, wie Banknoten, Ausweiskarten oder dergleichen, mit einem solchen Gitterbild.

Hologramme, holographische Gitterbilder und weitere optisch variable Beugungsstrukturen werden als Sicherheitselemente gegen Fälschungen bei Kreditkarten, Banknoten, Produktverpackungen und dergleichen verwendet. Im Allgemeinen beginnt die Herstellung dieser Beugungsstrukturen mit der Belichtung einer lichtempfindlichen Schicht durch überlagerte, kohärente Lichtstrahlen.

Echte Hologramme entstehen, indem ein Objekt mit kohärentem Laserlicht beleuchtet wird, wobei von dem Objekt gestörtes Laserlicht mit einem ungestörten Referenzstrahl in der lichtempfindlichen Schicht überlagert wird.

Holographische Beugungsgitter entstehen, wenn die in der lichtempfindlichen Schicht überlagerten Lichtstrahlen aus räumlich ausgedehnten, einheitlichen, kohärenten Wellenfeldern bestehen. Wenn man diese auf die lichtempfindliche Schicht, z.B. einen photographischen Film oder eine Photore-sistschicht einwirken lässt, entsteht ein holographisches Beugungsgitter, das z.B. in einem photographischen Film als helle und dunkle Linien oder in einer Photoresistschicht als Berge und Täler konserviert wird. Da die Lichtstrahlen in diesem Falle durch kein Objekt gestört werden, ergibt sich lediglich ein optisch variabler Farbeffekt, jedoch keine Bilddarstellung.

Holographische Gitterbilder lassen sich aus holographischen Beugungsgittern erzeugen, wenn nicht die gesamte Fläche des lichtempfindlichen Materials mit einem einheitlichen holographischen Beugungsgitter belegt wird, sondern wenn Masken verwendet werden, so dass nur Teile der Aufnahme-  
5 fläche mit einem einheitlichen Gittermuster belegt werden, während andere Teile der Aufnahmefläche über andere Masken mit anderen Gittermustern belegt werden können. Ein holographisches Gitterbild setzt sich somit aus mehreren Gitterfeldern mit unterschiedlichen Beugungsgittermustern zusammen. Mit einem aus der Summe der Gitterfelder gebildeten Gitterbild  
10 lassen sich unterschiedlichste Bildmotive darstellen.

Üblicherweise handelt es sich bei den Beugungsgittern eines holographischen Gitterbildes um Strichgitter mit einer Vielzahl von nebeneinander liegenden Gitterlinien. Die Beugungsgitter eines jeden Gitterfelds bzw. Bild-  
15 felds des Gitterbilds sind dabei jeweils durch die Gitterkonstante, den Azimutwinkel und die Kontur oder den Umriss gekennzeichnet. Die Gitterkonstante entspricht dabei dem Abstand der Gitterlinien und der Azimutwinkel beschreibt die Neigung der Gitterlinien bezüglich einer Referenzrichtung. Die Gitterkonstante und der Azimutwinkel werden durch die Wellenlänge  
20 und Einfallrichtung der belichtenden Wellenfelder eingestellt. Die Umrisse der Bildfelder werden mit Hilfe von Masken erzeugt.

Die Gitterkonstanten der Gittermuster in den einzelnen Bildfeldern sind wesentlich für die Farben im Gitterbild, während die Azimutwinkel der Gittermuster in den Bildfeldern für die Sichtbarkeit dieser Bildfelder in bestimmten Richtungen verantwortlich sind. Auf der Grundlage dieser Technik können daher optisch variable Bilder, z. B. bewegte Bilder oder auch plastisch wirkende Bilder, erzeugt werden.  
25

Ganz allgemein lässt sich festhalten, dass ein echtes Hologramm eine Überlagerung von holographischen Beugungsgittern ist, wohingegen in einem holographischen Gitterbild mehrere holographische Beugungsgitter nebeneinander angeordnet sind. Im Allgemeinen wirken echte Hologramme im Vergleich zu Gitterbildern photographisch-lebensecht. Gitterbilder können dagegen graphisch gestaltet werden. Außerdem sind Gitterbilder lichtstärker als echte Hologramme, da die nebeneinander liegenden ungestörten Beugungsgitter intensiver leuchten als die überlagerten gestörten Beugungsgitter.

10

Die nebeneinander liegenden Beugungsgitter können holographisch auf verschiedene Weise hergestellt werden. Zum einen ist es möglich, das Gitterbild in großflächige Bildfelder aufzuteilen und dafür deckende Masken zu entwickeln, die jeweils nur eine Belichtung eines Bildfelds mit einem einheitlichen holographischen Beugungsgitter zulassen. Zum anderen kann das gesamte Gitterbild jedoch auch in eine Vielzahl von kleinen, nahezu punktförmigen Bereichen zerlegt werden, wobei diese Punktbereiche einen Durchmesser von 10 bis 200 Mikrometer haben. In den Punktbereichen können dann mit Hilfe einer Dot-Matrix-Maschine holographische Beugungsgitter ausgebildet werden.

20

Insbesondere bei fein strukturierten Gitterfeldern mit unterschiedlichen Gitterdaten ist die Maskentechnik umständlich in der Handhabung. Denn die Masken müssen beim Belichten in sehr engen Kontakt mit der lichtempfindlichen Schicht gebracht und sehr genau positioniert werden, was handwerkliches Geschick und Fingerfertigkeit erfordert.

25

Auch die Herstellung der in Punktbereiche zerlegten Gitterbilder ist nicht unproblematisch. Zwar können die in Punktbereiche zerlegten Gitterbilder

automatisch maschinell und ohne handwerkliches Geschick hergestellt werden, aber dafür wird die Intensität des reflektierten Lichts durch die Zwischenräume zwischen den Punktbereichen gemindert. Darüber hinaus werden die Farben des reflektierten Lichts verfälscht, da die Gitter kleinflächig  
5 zusammengesetzt und nicht großflächig einheitlich sind. Weitere Nachteile sind die Erkennbarkeit der Punkterlegung unter der Lupe sowie der geringe Sicherheitswert, da Dot-Matrix-Maschinen leicht verfügbar sind.

Darüber hinaus ist es bekannt, die Punktbereiche eines quasi aufgerasterten  
10 Gitterbildes mittels eines Elektronenstrahls zu erzeugen. Die vorgenannten, mit der Punkterlegung des Gitterbildes verbundenen Nachteile treffen aber in identischer Weise auch auf diese Herstellungsvariante zu.

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe  
15 zugrunde, ein Verfahren zum Erzeugen von Gitterbildern anzugeben, das zu optisch variablen Gitterbildern hoher Lichtstärke führt, für den Hersteller von Gitterbildern zuverlässig durchführbar ist und den Zugang für Nachahmer erschwert, indem es keine Zerlegung der Gitterbilder in Punktbereiche verwendet.

20 Ferner liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein einfach herstellbares, optisch variables Gitterbild und ein Sicherheitsdokument mit einem solchen Gitterbild zu schaffen.

25 Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren, ein Gitterbild und ein Sicherheitselement mit den Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche gelöst. In davon abhängigen Ansprüchen sind vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung angegeben.

Die Erfindung ermöglicht es nun, auch große, mit bloßem Auge erkennbare Flächen eines Gitterbildes mit einem einheitlichen Gitter zu belegen, und zwar auf einfache, nicht-holographische Weise, z. B. mittels einer fokussierten Strahlung, insbesondere einem Elektronenstrahl. Das heißt, ein darzu-

5 stellendes Motiv wird in einzelne Bildfelder zerlegt, die eine visuell erkennbare Ausdehnung haben und diese Bildfelder werden mit einem einheitlichen Gitter belegt. Auf diese Weise kann die Lichtintensität des Gitterbildes erhöht werden, da es keine unbelichteten Zwischenräume gibt. Auch die Verfälschung der Farben entfällt, da die Felder großflächig einheitlich mit

10 einem Gitter belegt sind und nicht aus kleinflächigen Punkten mit störenden Zwischenräumen zusammengesetzt sind.

Bei dem Verfahren werden zunächst Umrisslinien der Gitterfelder festgelegt, aus denen das Gitterbild besteht, und anschließend die Umrisslinien bzw.

15 die Gitterfelder mit einem gewünschten Gittermuster gefüllt. Im einfachsten Fall besteht ein Gitterbild aus einem einzelnen Gitterfeld, das eine dem darzustellenden Motiv entsprechende Umrisslinie aufweist. Die Bestandteile des Gittermusters innerhalb der Umrisslinie werden dann durch Gitterkoordinaten beschrieben, die einer Schreibvorrichtung zugeführt werden. Bei der

20 Schreibvorrichtung handelt es sich um eine Vorrichtung, die vorzugsweise mittels einer geeigneten Strahlung, insbesondere eines gebündelten Strahls, auf Grundlage der Gitterkoordinaten eine Zustandsänderung in einem strahlungsempfindlichen Substratmaterial herbeiführt, um so die Gitterfelder eines Gitterbildes in dem Substrat zu erzeugen.

25

Das Verfahren gemäß der Erfindung eignet sich insbesondere für die maschinelle automatische Erzeugung großflächiger Gitterfelder, da Umrisslinien für die Gitterfelder mithilfe von Computerprogrammen erstellt und mit Gittermustern gefüllt werden können. Computerprogramme sind auch in

der Lage, zur Beschreibung der Gittermuster geeignete Gitterkoordinaten an eine Vorrichtung zur Bearbeitung des strahlungsempfindlichen Materials auszugeben. Nach der Einrichtung eines Prozesses gemäß der Erfindung ist dem Hersteller eine wiederholte zuverlässige Durchführung des Verfahrens  
5 leicht möglich. Nachahmern ist dagegen der Zugang erschwert, da die Vorrichtungen, die das erfindungsgemäße Verfahren implementieren, nicht standardmäßig in dieser Kombination am Markt verfügbar und sehr teuer sind.

10 Hervorzuheben ist weiterhin, dass sich mit dem erfindungsgemäßen Verfahren lichtstarke Gitterbilder erzeugen lassen, da sich mit dem Verfahren nahezu beliebig große Gitterfelder erzeugen lassen.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform handelt es sich bei dem Gittermuster um ein Strichgitter, wobei die Schnittpunkte der Gitterlinien mit der  
15 Umrisslinie jeweils Anfangs- und Endpunkte der jeweiligen Gitterlinie definieren, deren Koordinaten der Schreibvorrichtung zur Bearbeitung des lichtempfindlichen Materials zugeführt werden.

20 Die erfindungsgemäße Vorgehensweise gestattet ein strukturiertes Abspeichern der erzeugten Gitterkoordinaten, die bei Bedarf an die Schreibvorrichtung transferiert werden können.

Die Gitterkoordinaten in der Datei werden darüber hinaus vorzugsweise so  
25 angeordnet, dass die Koordinaten des Anfangspunkts einer Gitterlinie neben den Koordinaten des Anfangspunkts einer benachbarten Gitterlinie und die Koordinaten eines Endpunkts einer Gitterlinie neben den Koordinaten des Endpunkts einer benachbarten Gitterlinie liegen. Eine solche Anordnung der Gitterkoordinaten ist von Vorteil, denn beim Abarbeiten der auf diese Weise



sortierten Gitterkoordinaten folgt der Strahl einer mäanderförmigen Linie, ohne lange Leerstrecken zurücklegen zu müssen.

Weiter von Vorteil ist es, wenn die Anfangs- und Endpunkte benachbarter  
5 Gitterlinien jeweils durch Umkehrstrecken verbunden sind, so dass der Strahl auch zwischen den Gitterlinien keine Leerstrecke durchfährt. In diesem Fall braucht der Strahl nicht zwischen den Gitterlinien abgeschaltet zu werden.

10 Zur weiteren Erhöhung der Schreibgeschwindigkeit des Strahls können die Umkehrstrecken auch verrundet ausgebildet werden.

Die Erfindung ist jedoch nicht auf die Verwendung von Strichgittern als Gittermuster beschränkt. Statt gerader Gitterlinien können auch geschwungene,  
15 wellenförmige oder beliebige andere nicht geradlinige Gittermuster verwendet werden. In diesem Fall genügt es nicht, die Koordinaten der Schnittpunkte der das Gittermuster bildenden Gitterlinien mit der Umrisslinie als Anfangs- und Endpunkte zu speichern. Es müssen darüber hinaus Informationen bezüglich des Verlaufs der Gitterlinien innerhalb der Umrisslinie zur  
20 Verfügung gestellt werden. Hierfür können die Koordinaten von beliebig vielen Zwischenpunkten verwendet werden, die als Polygonzug die Form der Gitterlinie beschreiben. Alternativ kann die Form der Gitterlinie auch als Bezier-Kurve beschrieben werden, bei welcher lediglich die Koordinaten weniger Zwischenpunkte und zusätzlich eine Tangentialrichtung bezüglich  
25 des weiteren Kurvenverlaufs gespeichert werden.

Der Elektronenstrahl als Lithographieinstrument erlaubt sehr feine Auflösungen bis in den Nanometer-Bereich. Deswegen wird er erfindungsgemäß bevorzugt. In Fällen, in welchen Gittermuster geschrieben werden sol-

len, ohne dass diese hohe Auflösung benötigt wird, kommen auch andere Lithographieinstrumente infrage, um die erfindungsgemäßen Gitterlinien in ein Substrat einzubringen. Hierbei kann es sich beispielsweise um eine mechanische Gravur mit einer Präzisionsfräsvorrichtung oder einen fokussierten UV-Laser handeln. Erfindungsgemäß können alle Lithographieinstrumente eingesetzt werden, die es erlauben, aus den beschriebenen Datensätzen Striche bzw. Linien zu ziehen, die jeweils von einem Anfangspunkt bis zu einem Endpunkt in genügend feiner Strichstärke in ein geeignetes Substrat eingeschrieben werden.

10

Die erfindungsgemäßen Gitterbilder können in beliebig geformte Prägestempel umgesetzt werden, die anschließend zur Prägung einer beliebigen prägbaren Schicht, wie beispielsweise einer thermoplastischen Schicht oder einer Lackschicht, insbesondere einer UV-härtbaren Lackschicht verwendet werden. Diese prägbare Schicht befindet sich vorzugsweise auf einem Träger, wie einer Kunststofffolie. Je nach Verwendungszweck der Kunststofffolie kann diese zusätzliche Schichten oder Sicherheitsmerkmale aufweisen. So kann die Folie als Sicherheitsfaden oder Sicherheitsetikett eingesetzt werden. Alternativ kann die Folie als Transfermaterial, wie beispielsweise in Form einer Heißprägefolie, ausgestaltet sein, die zum Übertrag einzelner Sicherheitselemente auf zu sichernde Gegenstände dient.

20

Die erfindungsgemäßen Gitterbilder werden vorzugsweise zur Absicherung von Werdokumenten, wie Banknoten, Ausweiskarten, Pässen und dergleichen, benutzt. Selbstverständlich können sie auch für andere zu sichernde Waren, wie CDs, Bücher, etc., eingesetzt werden.

25

Gemäß der Erfindung ist es auch nicht unbedingt notwendig, das gesamte Gitterbild aus Gitterfeldern gemäß der Erfindung zusammenzusetzen. Viel-

mehr können auch nur Teile eines Gesamtbildes in Form der erfindungsgemäßen Gitterfelder ausgeführt sein, während andere Bildanteile mit anderen Verfahren gestaltet werden, wie beispielsweise holographischen Gittern oder echten Hologrammen oder einfachen Aufdrucken.

5

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der beigefügten Zeichnungen im Einzelnen erläutert. Es sei darauf hingewiesen, dass die Figuren keine maßgetreue Darstellung der Erfindung bieten, sondern lediglich der Veranschaulichung dienen. Es zeigen:

10

Figur 1 ein einfaches Gitterbild mit rautenförmigem Umriss;

Figur 2 ein Gitterbild, das aus großflächigen Gitterfeldern zusammengesetzt ist;

15

Figur 3 einen Ausschnitt B aus dem Gitterbild gemäß Figur 2, das im Dot-Matrix-Verfahren gemäß dem Stand der Technik hergestellt wurde;

20 Figur 4 einen Umriss eines erfindungsgemäßen Gitterfeldes;

Figur 5 ein Gittermuster, mit dem der Umriss aus Figur 4 gefüllt werden soll;

25 Figur 6 eine Überlagerung des Gittermusters aus Figur 5 mit der Umrisslinie aus Figur 4;

Figur 7 ein Gitterfeld, dessen Gitterlinien durch Anfangs- und Endpunkte beschrieben sind;

- Figur 8 ein Bearbeitungsweg für das Gitterfeld aus Figur 7;
- Figur 9 ein fertiges Gitterbild;
- 5 Figur 10 ein weiterer abgewandelter Bearbeitungsweg für das Gitterfeld aus Figur 7;
- Figur 11 der Bearbeitungsweg aus Figur 8 ohne Leerstrecken zwischen benachbarten Gitterlinien;
- 10 Figur 12 ein noch weiterer abgewandelter Bearbeitungsweg ohne Leerstrecken zwischen benachbarten Gitterlinien;
- Figur 13. Überlagerung eines wellenlinienförmigen Gittermusters mit der Umrisslinie aus Fig. 4; und
- 15 Figur 14 Gitterfeld, dessen Gitterlinien durch Anfangs- und Endpunkte sowie Zwischenpunkte beschrieben sind.
- 20 In Figur 1 ist ein Gitterbild 1 dargestellt, das aus einem einzelnen rautenförmigen Gitterfeld 2 besteht. Das Gitterfeld 2 ist mit einem Gittermuster ausgefüllt, das eine Vielzahl von nebeneinander angeordneten Gitterlinien 3 aufweist, die in einem Abstand  $a$  voneinander entfernt angeordnet sind. Der Abstand  $a$  wird auch als Gitterkonstante bezeichnet. Außerdem nehmen die
- 25 Gitterlinien 3 einen Azimutwinkel  $\alpha$  zu einer Referenzrichtung 4 ein. Die Gitterkonstante ist wesentlich für die Farbe des Gitterfelds, während der Azimutwinkel  $\alpha$  für die Sichtbarkeit des Gitterfeldes 2 in bestimmten Betrachtungsrichtungen verantwortlich ist.

In Figur 2 ist ein weiteres Gitterbild 5 dargestellt, das aus einer Vielzahl von Gitterfeldern 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66 zusammengesetzt ist. Direkt aneinander grenzende Gitterfelder unterscheiden sich wenigstens in einem Gitterparameter, wie z.B. der Gitterkonstante  $a$  oder dem Azimutwinkel  $\alpha$ , was in der Figur durch die unterschiedlichen Schraffuren veranschaulicht wird. Nicht  
5 direkt aneinander grenzende Gitterfelder können durchaus mit gleichen Gittermustern belegt werden. Diese Gitterfelder sind unter dem gleichen Betrachtungswinkel mit der gleichen Farbe visuell erkennbar. Im gezeigten Beispiel ist dies für die Gitterfelder 62 der Fall, welche die Augen des Ge-  
10 sichts darstellen. Sie werden daher auch mit der gleichen Schraffur belegt.

Gitterbilder, wie das in Figur 2 dargestellte Gitterbild 5, werden im Stand der Technik mit Hilfe von Masken und einer holographischen Belichtungs-  
technik hergestellt, indem räumlich ausgedehnte, einheitlich kohärente  
15 Wellenfelder in einer lichtempfindlichen Schicht überlagert werden. Dabei werden jeweils nur diejenigen Gitterfelder belichtet, die die gleiche Gitterkonstante  $a$  und den gleichen Azimutwinkel  $\alpha$  aufweisen.

Wird für die Herstellung des Gitterbildes 5 das bekannte Dot-Matrix-Verfahren  
20 verwendet, so wird jedes Gitterfeld 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66 aus einer Vielzahl von Punktbereichen 8 zusammengesetzt, wie sie in Figur 3 dargestellt sind. In Figur 3 ist stark vergrößert der Bereich B aus Figur 2 dargestellt, für den Fall, dass das Gitterbild 5 im Dot-Matrix-Verfahren hergestellt wurde. Es wird die Grenze zwischen zwei Gitterfeldern 64, 65 gezeigt, die mit unter-  
25 schiedlichen Gittermustern 7, 7' belegt sind, um unterschiedliche visuelle Eindrücke zu erzeugen. Hier wird jedoch nicht der gesamte Bereich eines Gitterfeldes 64, 65 mit dem jeweiligen Gittermuster 7, 7' versehen, sondern lediglich die Punktbereiche 8. Die in den Punktbereichen 8 angeordneten Gittermuster 7, 7' werden entweder auf holographischem Wege durch die

- Überlagerung von kohärenten Wellenfeldern erzeugt oder mit Elektronenstrahl geschrieben. Diese Punktbereiche 8 sind durch nicht beugende Zwischenbereiche voneinander getrennt. Wie bereits erwähnt, führen diese Zwischenbereiche zu einer Minderung der Lichtintensität, d.h. das Gitterfeld bzw. das Gitterbild erscheint weniger brillant. Werden die Punktbereiche direkt aneinander gesetzt, so müssen sie aufgrund der Fertigungstoleranzen überlappend angeordnet werden. Auch diese Überlagerung führt zu sichtbaren Störeffekten, wie Farbverfälschungen.
- 5
- 10 Gemäß der Erfindung wird jedes der Gitterfelder 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66 des Gitterbildes 5 in sich einheitlich mit einem durchgehenden Gittermuster belegt, das mit Hilfe eines steuerbaren Licht- oder Teilchenstrahls, insbesondere eines Elektronenstrahls, erzeugt wird.
- 15 Im Folgenden wird das Verfahren zur Erzeugung der erfindungsgemäßen Gitterfelder 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66 erläutert.

- In einem ersten Verfahrensschritt wird gemäß Figur 4 eine Umrisslinie 9, die der Umrisslinie des späteren Gitterfeldes 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66 entspricht, erstellt. Dazu kann auf handelsübliche Zeichenprogramme, wie beispielsweise Adobe-Illustrator, Macromedia-Freehand, Corel-Draw oder dergleichen zurückgegriffen werden. Umrisslinien 9 bzw. Gitterfelder 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, die mit unterschiedlichen Gittermustern gefüllt werden sollen, werden vorzugsweise separat, z.B. in verschiedenen Ebenen des Zeichenprogramms oder in verschiedenen Dateien erstellt. Um die Übersichtlichkeit der von den Umrisslinien 9 angedeuteten Zeichnung zu erhöhen, können in den Umrisslinien 9 liegende Flächen im Zeichenprogramm in unterschiedlichen Farben eingefärbt werden.
- 20
- 25

In einem weiteren Verfahrensschritt wird in dem Zeichenprogramm ein Gittermuster 10 erzeugt, wie es beispielsweise in Figur 5 dargestellt ist. In Figur 5 setzt sich das Gittermuster 10 aus einer Vielzahl von Schraffurlinien 11 zusammen, die den späteren Gitterlinien entsprechen. Da gängige Zeichenprogramme nicht im Mikrometerbereich oder darunter arbeiten und der Abstand zwischen den tatsächlichen Gitterlinien typischerweise im Bereich zwischen 0,5 und 2 Mikrometer liegt, wird das Gittermuster 10 vergrößert gezeichnet. Die Vergrößerung kann beispielsweise 10-fach, 100-fach oder 1000-fach sein. Das so erstellte Gittermuster 10 sieht im Computerbild wie eine Schraffur aus, die sich über einen Zeichenbereich 12 erstreckt.

Das Gittermuster kann aber auch aus wellenförmigen oder beliebig anders geformten Gitterlinien bestehen. Im Zeichenprogramm werden diese Gitterlinien, wie bereits erwähnt, beispielsweise als Polygonzüge oder Bezier-Kurven beschrieben.

Nun werden gemäß Figur 6 Werkzeuge aus dem Zeichenprogramm angewandt, welche es gestatten, die im ersten Verfahrensschritt erzeugte Umrisslinie 9, die im gleichen Maßstab vergrößert ist wie das Gittermuster, mit dem Gittermuster 10 so zu verknüpfen, dass das Gittermuster 10 nur innerhalb der Umrisslinien 9 erhalten bleibt.

Dadurch entstehen die in Figur 7 dargestellten Gitterlinien 13, die jeweils durch einen Anfangspunkt 14 und einen Endpunkt 15, d. h. den Schnittpunkten der Gitterlinien 13 mit der Umrisslinie 9, definiert sind und zusammen ein Gitterfeld 16 bilden. Es ist darauf zu achten, dass möglichst nur die Gitterlinien 13 stehen bleiben und alle Umrisslinien 9 entfernt sind.

Die Datei des Zeichenprogramms wird nun in ein übliches objektorientiertes Format transformiert, in welchem Geradenstücke durch ihre Anfangs- und Endpunkte beschrieben werden. Jede Gitterlinie 13 wird nun durch einen Anfangspunkt 14 und einen Endpunkt 15 beschrieben. Ein geeignetes  
5 objektorientiertes Format ist z.B. das EPS-(Encapsulated Postscript) Format.

Für den Fall, dass die Gitterlinien nicht geradlinig sind, wird nach dem gleichen Verfahren vorgegangen. Für eine eindeutige Charakterisierung der in der Umrisslinie 9 liegenden Teilstücke des Gittermusters genügen in diesem  
10 Fall jedoch nicht allein die Schnittpunkte. Die die Gitterlinien beschreibenden mathematischen Funktionen sind hierbei zu berücksichtigen.

Falls das Zeichenprogramm keine Werkzeuge zum Verknüpfen des Gittermusters 10 mit der Umrisslinie 9 enthält, kann wie folgt verfahren werden:  
15

In einem selbst geschriebenen Programm, z.B. in Visual C++, werden die Schraffurlinien 11 im gewünschten Abstand und im gewünschten Neigungswinkel erzeugt. Die Umrisslinie 9 aus einer Datei in EPS-Format wird als Polygonzug in das selbst geschriebene Programm eingelesen. Die  
20 Schnittpunkte der Schraffurlinien 11 mit der Umrisslinie 9 sind die Anfangspunkte 14 und Endpunkte 15 der Gitterlinien 13, die in den folgenden Verfahrensschritten benötigt werden.

Die Datei in EPS-Format mit den Objektdaten der Anfangspunkte 14 und der  
25 Endpunkte 15 muss nun aufbereitet werden. Im Einzelnen müssen die Objekte der Anfangspunkte 14 und der Endpunkte 15 auf den richtigen Maßstab gebracht und in einer geeigneten Reihenfolge angeordnet werden.



Mit einem geeigneten Suchprogramm lassen sich in der Datei in EPS-Format die Objektdaten der Anfangspunkte 14 und der Endpunkte 15 finden. Dabei stellt man im Allgemeinen fest, dass diese Objektdaten ziemlich ungeordnet abgespeichert sind. Man schreibt daher ein Programm, das zu jedem Anfangspunkt 14 oder Endpunkt 15 einer Gitterlinie 13 den nächstgelegenen Anfangspunkte 14 oder Endpunkt 15 einer weiteren Gitterlinie 13 findet und ordnet die Gitterlinien in dieser Reihenfolge an. Wenn man nun bei jeder zweiten Gitterlinie 13 den Anfangspunkt 14 und den Endpunkt 15 vertauscht, dann ergibt sich ein in Figur 8 dargestellter mäanderförmiger Bearbeitungsweg 17. Denn die Gitterlinien 13 sind durch in Figur 8 gestrichelt eingezeichnete Leerstrecken 18 mäanderförmig untereinander verbunden.

Weiterhin bringt man die Objektdaten der Anfangspunkte 14 und der Endpunkte 15 auf den gewünschten Maßstab. Falls beispielsweise beim Zeichnen um einen Faktor 1000 vergrößert wurde, interpretiert man die Millimeterangaben im Datensatz als Mikrometerangaben.

Nunmehr stehen Datensätze zur Verfügung, die nur aus den Anfangspunkten 14 und den Endpunkten 15 der Gitterlinien 13 bestehen. Die Gitterlinien 13 sollen in eine Elektronenstrahl-Lithographie-Maschine geschrieben werden, die im so genannten CPC (Continuous Path Control) -Modus arbeitet. Dies ist ein Modus, bei dem die durch Anfangspunkte 14 und Endpunkte 15 gekennzeichneten Gitterlinien 13 durchgehend geschrieben werden können, im Gegensatz zum meistens verwendeten, so genannten „Stitching“, bei dem alle Bildbestandteile, also auch die Linien, in kleine Elemente zerlegt werden.

Als Substrat lässt sich z.B. eine Quarzglasplatte verwenden, die mit einer dünnen Chromschicht versehen ist und auf die eine Photoresistschicht aufgebracht ist. Die Photoresistschicht ist so dick, wie es die gewünschte Tiefe

des Bilderreliefs erfordert. Vorzugsweise beträgt die Dicke der Photoresistschicht einige 100 Nanometer. Das Substrat und die erstellten Datensätze werden der Elektronenstrahl-Lithographie-Maschine zugeführt und der Lithographieprozess gestartet. Nachdem alle Datensätze des Gitterbilds abgearbeitet sind, wird das Substrat aus der Maschine entnommen und die Photoresistschicht entwickelt. Als Endergebnis erhält man das gewünschte Gitterbild als Berg- und Tal-Profil auf der Quarzglasplatte.

Der Photoresist-Master wird nun in der üblichen Weise wie bei der optischen Holographie weiter verarbeitet. Zunächst wird eine dünne Silberschicht auf die Photoresistschicht durch Bedampfen oder chemischen Niederschlag aufgetragen. Anschließend wird in einem Galvanikbad eine Nickelabformung vom Photoresist-Master erzeugt, vervielfacht und als Prägestempel zum Prägen einer Prägeschicht verwendet. Ein derartiges geprägtes Gitterbild 19 ist in Figur 9 dargestellt. Dabei sind Vertiefungen 20 in der Prägeschicht durch dunkle Linien dargestellt. Je nach Herstellungsverfahren können die dunklen Linien jedoch auch Erhöhungen darstellen. Die fertig geprägte Prägeschicht wird schließlich auf das endgültige Substrat, z.B. eine Banknote, Kreditkarte oder Verpackungsmaterial, transferiert. Die Prägeschicht befindet sich hierbei entweder auf dem endgültigen Substrat oder bildet dieses Substrat. Dies kann beispielsweise bei Folien der Fall sein, die später in Ausweiskarten, Banknoten oder Sicherheitselemente, wie Sicherheitsfäden oder Etiketten, geschnitten werden. Alternativ kann die Prägeschicht auch auf einem Zwischenträger, wie einem Transfermaterial, angeordnet sein. Vorzugsweise handelt es sich bei dem Transfermaterial um eine Heißprägefolie. Sie besteht im einfachsten Fall aus einer Trägerfolie, auf die eine thermoplastische Schicht oder eine Lackschicht, vorzugsweise eine UV-härtbare Lackschicht, aufgebracht ist. In diese Lackschicht bzw. thermoplastische Schicht wird mithilfe des erfindungsgemäßen Prägestempels das Gitterbild 19 übertragen.

terbild übertragen. Anschließend wird die Prägeschicht mit einer metallischen oder dielektrischen Schicht versehen, die dafür sorgt, dass das Gitterbild in Reflexion beobachtet werden kann. Anschließend wird der Schichtaufbau mit einer Kleberschicht versehen, die beim Übertrag mit dem Endsubstrat bzw. einem zu sichernden Gegenstand in Kontakt gebracht wird.  
5 Nach dem Übertrag wird die Trägerfolie vorzugsweise abgezogen.

Alle Ausführungsformen des Sicherheitselements, Sicherheitsdokuments, Sicherheitspapiers oder anderer zu sichernder Gegenstände können neben  
10 dem erfindungsgemäßen Gitterbild weitere Sicherheitsmerkmale, wie maschinell lesbare Schichten oder andere visuell prüfbare Merkmale aufweisen.

Der in Figur 8 dargestellte mäanderförmige Bearbeitungsweg 17 wird gegenüber einem in Figur 10 dargestellten natürlichen Bearbeitungsweg 21, der  
15 in Zick-Zack-Form verläuft, im Allgemeinen bevorzugt. Insbesondere sind die Leerstrecken, in denen der Elektronenstrahl inaktiv ist, bei dem mäanderförmigen Bearbeitungsweg 17 optimal verkürzt. Gelegentlich kann jedoch auch der in Figur 10 dargestellte natürliche Bearbeitungsweg von Vorteil sein, wenn beispielsweise die Schreibvorrichtung zu Kühlzwecken zwischen zwei Schreibvorgängen abgeschaltet werden muss. Da der natürliche  
20 Bearbeitungsweg 21 in Zick-Zack-Form über lange Leerstrecken 22 verfügt, kann die Abschaltung entlang den Leerstrecken 22 durchgeführt werden.

Ein weiterer Vorteil des mäanderförmigen Bearbeitungswegs 17 ist, dass der  
25 Elektronenstrahl entlang den kurzen Leerstrecken 18 am Rand des Gitterfelds 16 nicht deaktiviert werden muss, da am Rande des Gitterfeldes 16 angeordnete kurze Verbindungsstücke 23 die optische Funktion des Gitterfelds 16 nicht beeinträchtigen. Daher kann mit dem Elektronenstrahl auch der in

Figur 11 dargestellte Bearbeitungsweg 17 in der Form eines weitgehend durchgehenden Polygonzugs geschrieben werden.

5 Zur weiteren Erhöhung der Schreibgeschwindigkeit können die Ecken der Verbindungsstücke 23 auch verschliffen oder abgerundet werden. Ein entsprechend modifizierter Bearbeitungsweg 17 ist in Figur 12 dargestellt.

Die Figuren 13 und 14 sind analog zu den Figuren 6 und 7 zu verstehen, wobei das mit der Umrisslinie 9 überlagerte Gittermuster 30 nicht aus geraden  
10 Linien 11 besteht, sondern aus wellenförmigen Gitterlinien 31. Die Gitterlinien 31 des Gittermusters 30 sind zudem so angeordnet, dass der Gitterabstand entlang einer Gitterlinie 31 von links nach rechts zunimmt, wie aus Figur 13 ersichtlich. Das Gittermuster 30 bzw. die einzelnen Gitterlinien 31 werden dabei, wie bereits erläutert, durch Polygonzüge oder Bezier-Kurven  
15 beschrieben.

Analog zu dem im Zusammenhang mit den Figuren 6 und 7 erläuterten Verfahren werden auch hier die Schnittpunkte 32, 33 der einzelnen Gitterlinien 31 mit der Umrisslinie 9 bestimmt. Im Gegensatz zu den geradlinigen Gitter-  
20 linien genügen jedoch diese Schnittpunkte 32 und 33 nicht, um die Gitterlinien 31 vollständig zu beschreiben. Der zu diesem Gitterfeld gehörende Datensatz enthält daher neben den Koordinaten der Schnittpunkte 32 und 33 auch Koordinaten mehrerer oder vieler Zwischenpunkte innerhalb der Umrisslinie 9.

25

Es wird darauf hingewiesen, dass die Abbildungen rein schematisch sind und lediglich der Veranschaulichung dienen. In der Praxis liegen die Umrisslinien bzw. die Ausdehnung der Gitterfelder im Millimeter- und Zentimeter-Bereich. Die Gitterlinienabstände liegen im Mikrometer-Bereich und

darunter. D.h., wenn in den Figuren einige wenige Gitterlinien gezeichnet sind, entspricht dies in der Praxis bis zu mehreren tausend Gitterlinien. Der Elektronenstrahl als Lithographieinstrument erlaubt sehr feine Auflösungen bis in den Nanometerbereich. Deswegen wird er bevorzugt verwendet. In Fällen, in denen Gitter geschrieben werden sollen, ohne dass diese hohe Auflösung benötigt wird, kommen auch andere Lithographieinstrumente infrage, um die Gitterlinien 13 in einem Substrat auszubilden. Mögliche Verfahren sind eine mechanische Gravur mit einer Präzisionsfräsvorrichtung oder eine andere Materialabtragung, z. B. mit einem fokussierten UV-Laser. Grundsätzlich können alle Instrumente eingesetzt werden, die es erlauben, auf Grundlage der oben genannten Datensätze jeweils ausgehend von einem Anfangspunkt und an einem Endpunkt endend, Linien in genügend feiner Strichstärke in einem geeigneten Substrat zu ziehen. Solche Materialbearbeitungen hinterlassen in dem Substrat charakteristische Spuren, aufgrund welcher der Fachmann zumindest mittels eines Elektronenmikroskops erkennen kann, welcher Instrumenttyp zur Erzeugung der Linien in dem Substrat verwendet wurde.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Erzeugen eines Gitterbildes (16, 19), das wenigstens ein Gitterfeld (6, 61, 62, 63, 64, 65, 66) aufweist, mit folgenden Schritten:  
5  
- Festlegen einer Umrisslinie (9) des Gitterfeldes (6, 61, 62, 63, 64, 65, 66),  
- Füllen der Umrisslinie (9) mit dem Gittermuster (10) , wobei das Gittermuster (10) innerhalb der Umrisslinie (9) durch Gitterkoordinaten beschrieben wird,  
10  
- Zuführen der Gitterkoordinaten an eine Schreibvorrichtung und  
15  
- Erzeugen des Gittermusters (10) in einem Substrat mit der Schreibvorrichtung und anhand der Gitterkoordinaten.
2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Gittermuster (10) von nebeneinander angeordneten Gitterlinien (13) gebildet wird.  
20
3. Verfahren nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass als Gitterkoordinaten die Schnittpunkte der Gitterlinien (13) mit der Umrisslinie (9) sowie gegebenenfalls innerhalb der Umrisslinie liegende Gitterpunkte des Gitterfeldes (6, 61, 62, 63, 64, 65, 66) ausgewählt werden.  
25
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass mithilfe einer Datenverarbeitungsanlage die Umrisslinie des

Gitterfeldes (6, 61, 62, 63, 64, 65, 66) erstellt und mit dem Gittermuster (10) gefüllt wird.

5. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Gitterlinien geradlinig oder geschwungen sind.  
5
6. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Gitterkoordinaten der Gitterlinien (13) sequentiell ihren räumlichen Anordnungen entsprechend sortiert werden.  
10
7. Verfahren nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Koordinaten eines Anfangspunkts (14) einer Gitterlinie (13) jeweils neben den Koordinaten eines Anfangspunkts (14) einer benachbarten Gitterlinie (13) und die Koordinaten eines Endpunkts (15) einer Gitterlinie (13) jeweils neben den Koordinaten eines Endpunkts (15) einer weiteren benachbarten Gitterlinie (13) sortiert werden.  
15
8. Verfahren nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Anfangs- und Endpunkte von nebeneinander liegenden Gitterlinien (13) zu einem mäanderförmigen Bearbeitungsweg (17) verbunden werden.  
20
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Schreibvorrichtung mithilfe von Strahlung in einem strahlungsempfindlichen Material eine Zustandsänderung herbeiführt.  
25
10. Verfahren nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Schreibvorrichtung entsprechend den Gitterkoordinaten über das strahlungsempfindliche Material geführt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass als strahlungsempfindliches Material eine auf eine Substratplatte aufgebraachte Photoresistschicht verwendet wird.
- 5 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass als Schreibvorrichtung ein Elektronenstrahl verwendet wird.
- 10 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 12, **dadurch gekennzeichnet**, dass nach der herbeigeführten Zustandsänderung eine Metallisierungsschicht auf das strahlungsempfindliche Material aufgebracht wird und dass davon auf galvanischem Wege eine metallische Abformung erzeugt wird.
- 15 14. Verfahren nach Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Abformung als Prägestempel zum Prägen eines Gitterbildes in ein Substrat verwendet wird.
- 20 15. Gitterbild, welches wenigstens ein mit bloßem Auge separat erkennbares Bildfeld aufweist, in dem ein Gittermuster aus nicht unterbrochenen Gitterlinien angeordnet ist, welches mittels eines Lithographieinstruments erzeugt ist.
- 25 16. Gitterbild nach Anspruch 15, **dadurch gekennzeichnet**, dass als Lithographieinstrument fokussierte Lichtstrahlung oder ein fokussierter Teilchenstrahl, insbesondere ein Elektronenstrahl, verwendet wird.
17. Gitterbild nach Anspruch 15 oder 16, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Gitterbild mehrere Bildfelder aufweist.



- 23 -

18. Gitterbild nach wenigstens einem der Ansprüche 15 bis 17, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Gitterbild weitere Bildanteile aufweist, die in einer anderen Technik erzeugt sind.
- 5 19. Gitterbild, nach wenigstens einem der Ansprüche 15 bis 18, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Gittermuster aus Gitterlinien besteht, die ein Beugungsgitter bilden.
- 10 20. Gitterbild nach wenigstens einem der Ansprüche 15 bis 19, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Gitterlinien (13) durch an ihren Enden (14, 15) angeordnete Umkehrstücke (23) zu mindestens einer mäanderförmig verlaufenden Gitterlinie verbunden sind.
- 15 21. Gitterbild nach wenigstens einem der Ansprüche 15 bis 20, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Umkehrstrecken (23) verrundet sind.
22. Sicherheitselement mit einem Gitterbild gemäß wenigstens einem der Ansprüche 15 bis 21.
- 20 23. Sicherheitselement nach Anspruch 22, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Sicherheitselement ein Sicherheitsfaden, ein Etikett oder ein Transferelement ist.
- 25 24. Sicherheitspapier mit einem Gitterbild gemäß wenigstens einem der Ansprüche 15 bis 21.
25. Sicherheitspapier mit einem Sicherheitselement gemäß Anspruch 22 oder 23.

26. Sicherheitsdokument mit einem Gitterbild gemäß wenigstens einem der Ansprüche 15 bis 21.
27. Sicherheitsdokument mit einem Sicherheitselement gemäß Anspruch 22  
5 oder 23.
28. Sicherheitsdokument mit einem Sicherheitspapier gemäß Anspruch 24 oder 25.
- 10 29. Transfermaterial, insbesondere Heißprägefolie mit einem Gitterbild gemäß Anspruch 15 bis 21.
30. Vorrichtung zum Erzeugen eines Gitterbildes, das wenigstens ein mit bloßem Auge erkennbares Gitterfeld aufweist, mit folgenden Einrichtungen:  
15
- Einrichtung zur Festlegung einer Umrisslinie des Gitterfeldes,
  - Einrichtung zum Füllen der Umrisslinie mit einem Gittermuster, wobei das Gittermuster innerhalb der Umrisslinie durch Gitterkoordinaten beschrieben wird,  
20
  - Einrichtung zum Zuführen der Gitterkoordinaten an einer Schreibvorrichtung,  
25
  - Schreibvorrichtung zum Erzeugen des Gittermusters in einem Substrat anhand der Gitterkoordinaten.

- 25 -

31. Vorrichtung nach Anspruch 30, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Schreibvorrichtung ein Elektronenstrahl ist.

FIG 1

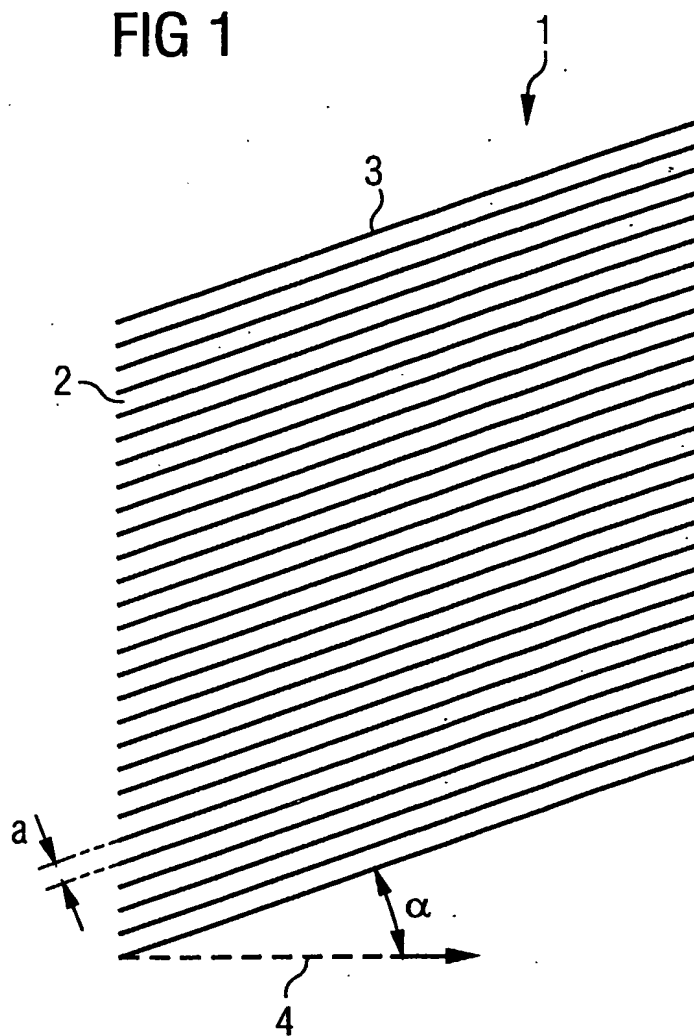
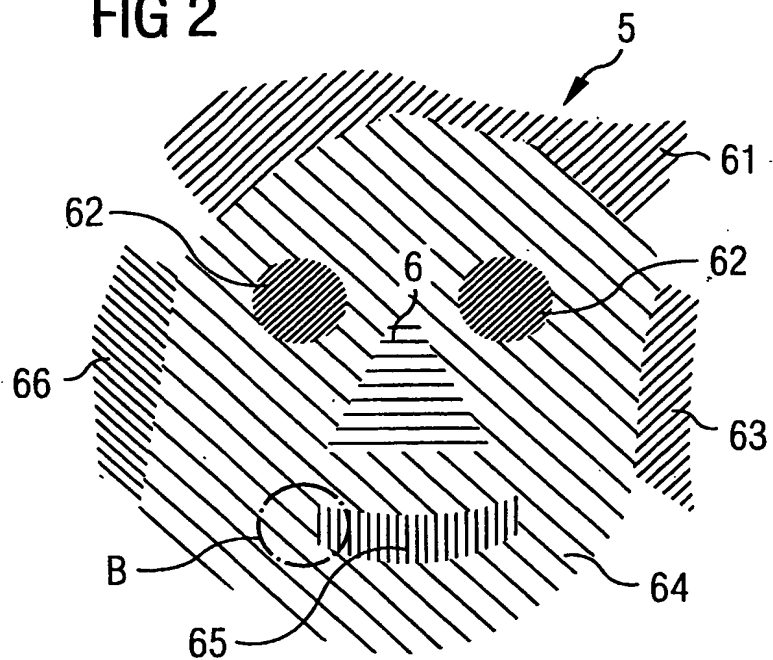


FIG 2



### FIG 3 Stand der Technik

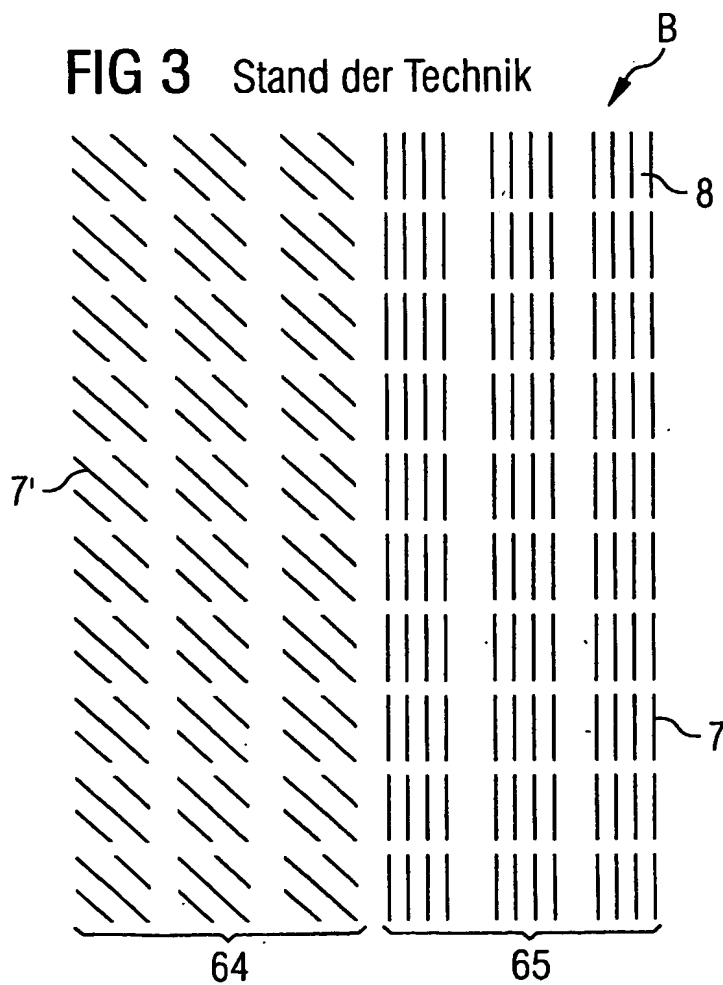


FIG 4

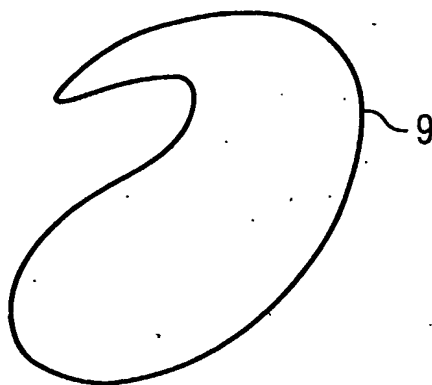


FIG 5

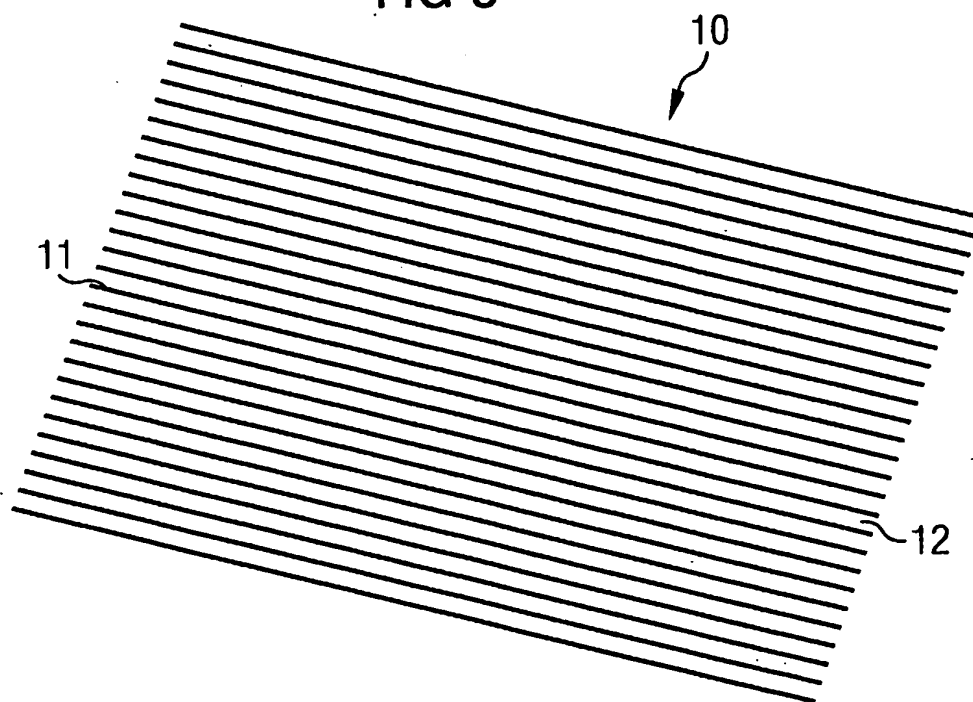


FIG 6

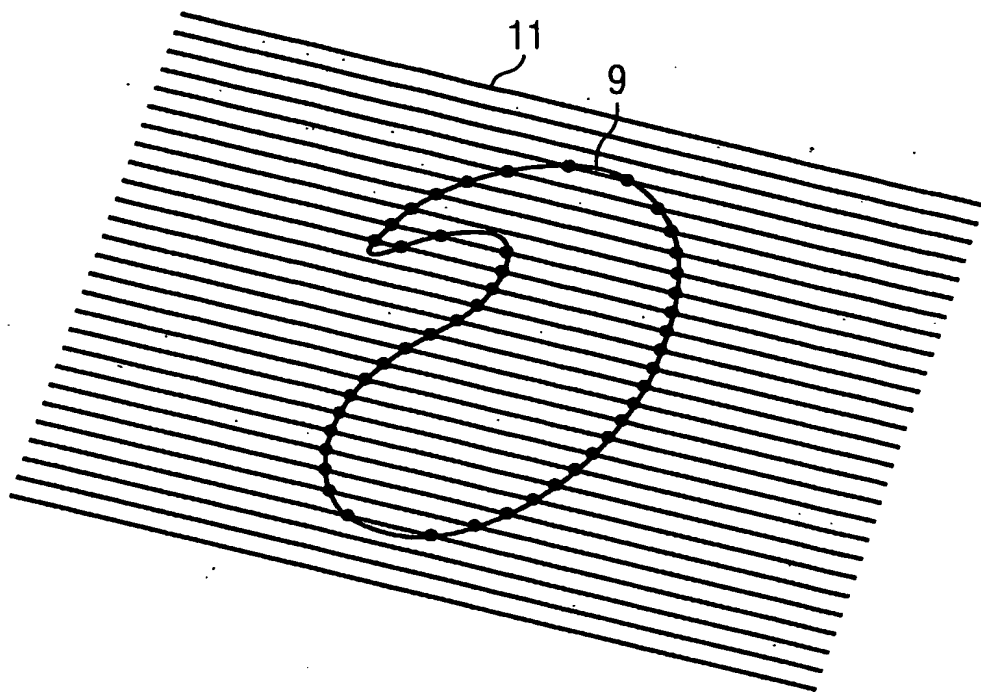


FIG 7

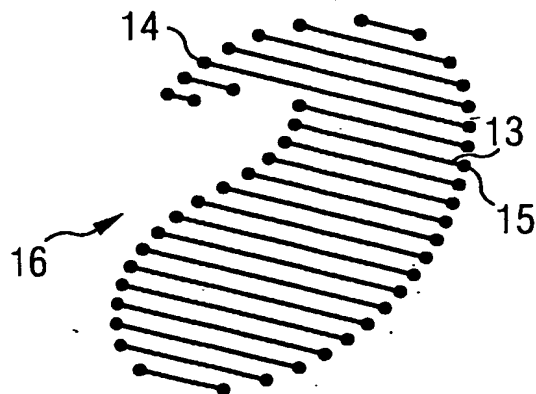


FIG 8

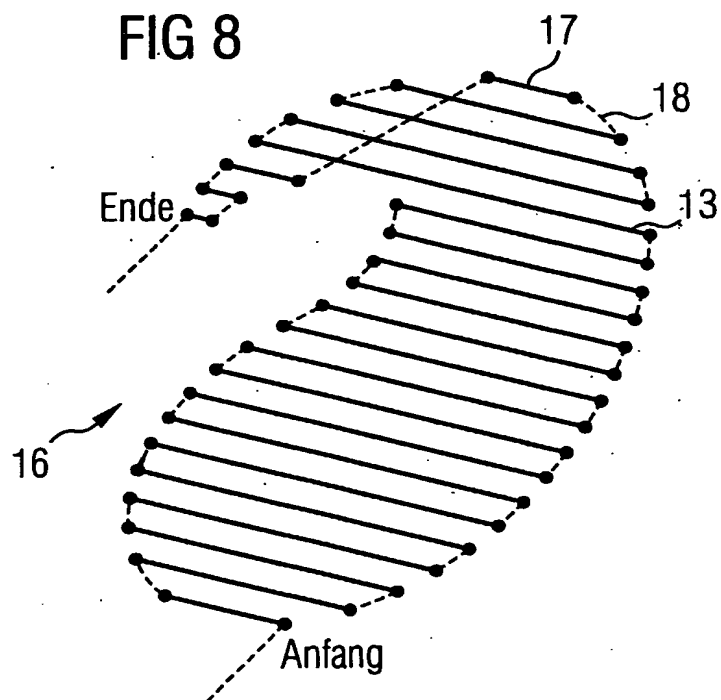


FIG 9

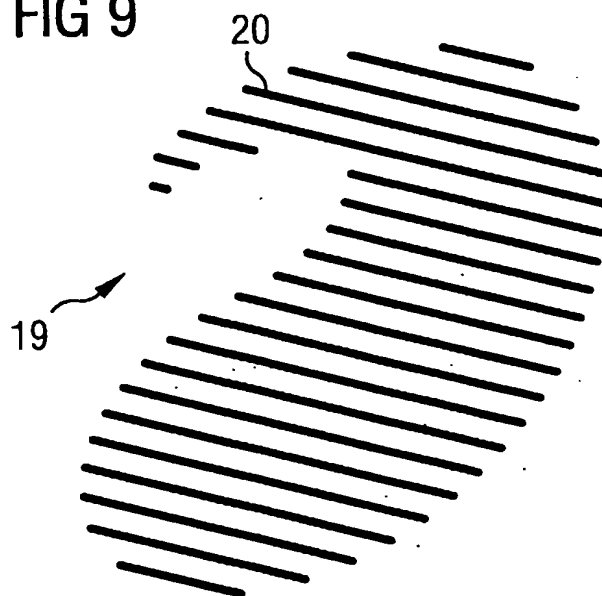




FIG 10

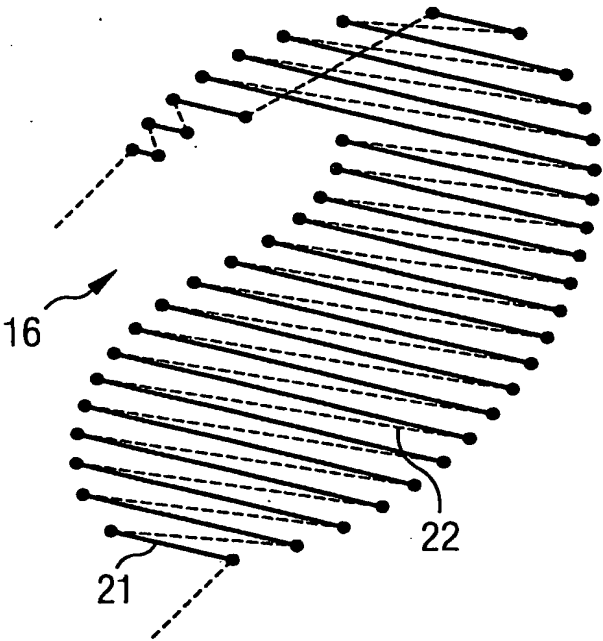


FIG 11

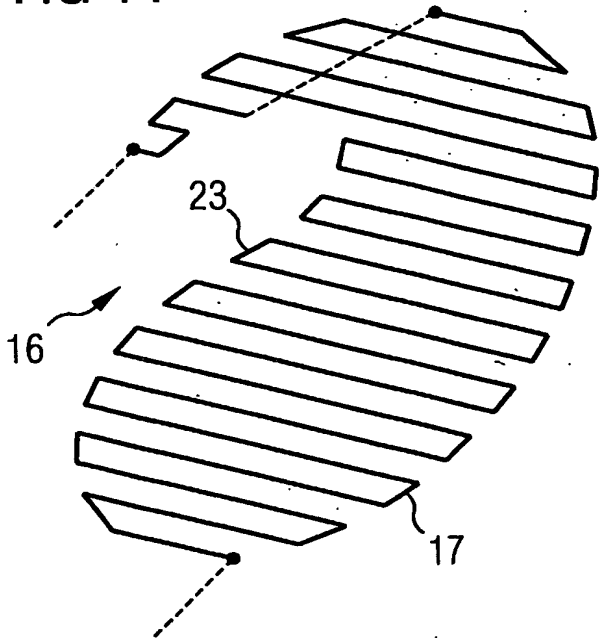


FIG 12

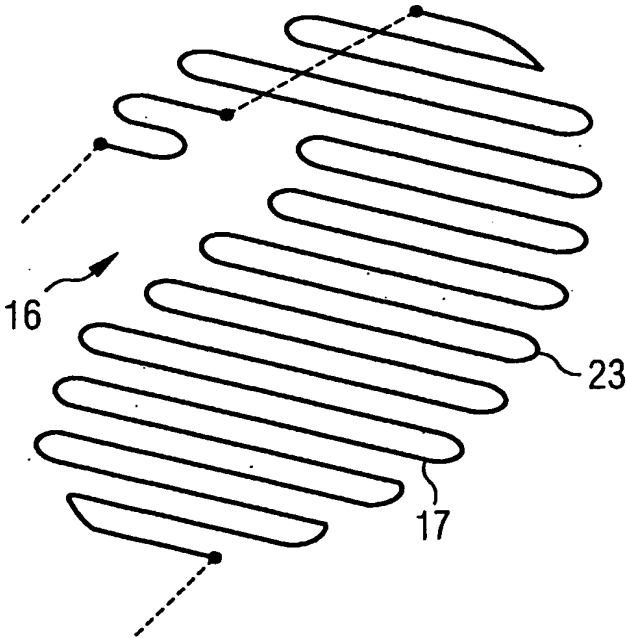


FIG 13

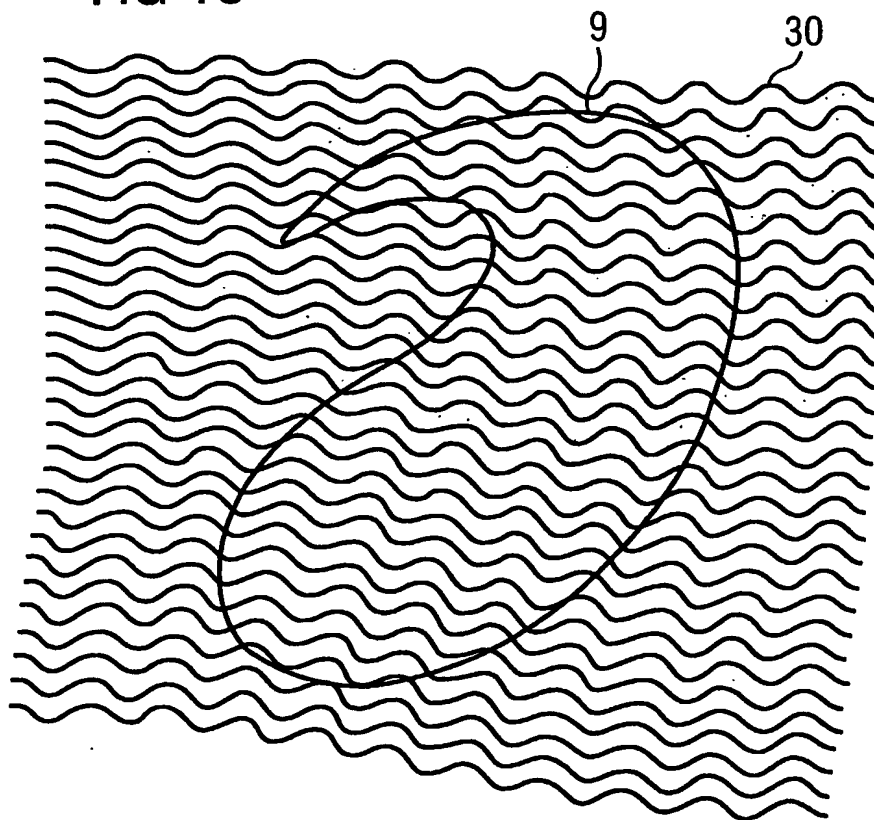
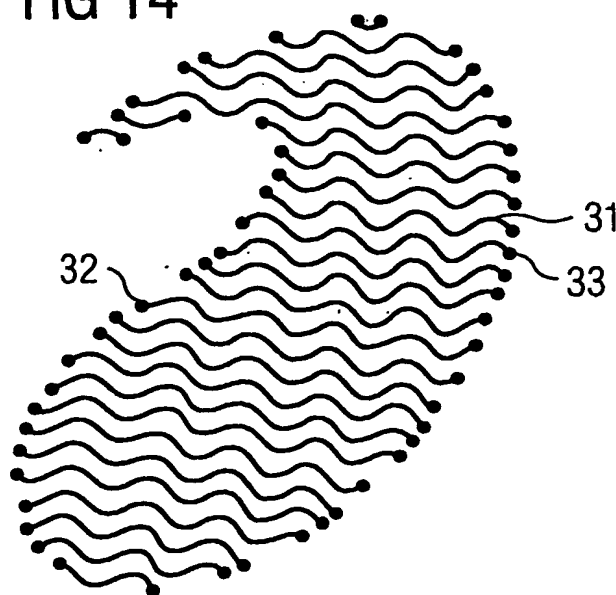


FIG 14



PCT/EP 03/06081

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
IPC 7 B42D15/10 G02B5/18 G03H1/30

IPC 7 B42D G02B G03H

EPO-Internal

-/-

Daffner, M

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP 03/06081

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 42 43 905 A (GAO GES AUTOMATION ORG) 30 June 1994 (1994-06-30) the whole document ---	1-31
A	EP 0 766 103 A (COMMW SCIENT IND RES ORG) 2 April 1997 (1997-04-02) the whole document ---	1-31
A	US 6 369 919 B1 (DRINKWATER KENNETH JOHN ET AL) 9 April 2002 (2002-04-09) the whole document -----	1-31

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Publication No

PCT/EP 03/06081

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 4576439	A	18-03-1986	AU 558221 B2	22-01-1987
			AU 1895783 A	22-03-1984
			CA 1229006 A1	10-11-1987
			CH 664533 A5	15-03-1988
			DE 3333220 A1	15-03-1984
			ES 282971 U	16-06-1985
			FR 2532966 A1	16-03-1984
			GB 2126949 A ,B	04-04-1984
			IT 1212089 B	08-11-1989
			JP 1670848 C	12-06-1992
			JP 3037233 B	04-06-1991
			JP 59071594 A	23-04-1984
			NL 8303172 A ,B,	02-04-1984
GB 2136352	A	19-09-1984	NONE	
DE 4243905	A	30-06-1994	DE 4243905 A1	30-06-1994
			CN 1091527 A	31-08-1994
			WO 9414621 A1	07-07-1994
			SI 9300679 A	30-06-1994
EP 0766103	A	02-04-1997	AT 208049 T	15-11-2001
			AT 201512 T	15-06-2001
			AU 3993197 A	15-01-1998
			AU 673100 B2	24-10-1996
			AU 7342194 A	28-02-1995
			WO 9504948 A1	16-02-1995
			CA 2168772 A1	16-02-1995
			DE 69427308 D1	28-06-2001
			DE 69427308 T2	06-09-2001
			DE 69428901 D1	06-12-2001
			DE 69428901 T2	27-06-2002
			DE 712500 T1	11-09-1997
			DE 766103 T1	11-09-1997
			EP 0712500 A1	22-05-1996
			EP 0766103 A1	02-04-1997
			JP 9502277 T	04-03-1997
			US 6088161 A	11-07-2000
			US 5825547 A	20-10-1998
US 6369919	B1	09-04-2002	AU 735608 B2	12-07-2001
			AU 3839799 A	29-11-1999
			BR 9910476 A	02-01-2001
			CA 2329936 A1	18-11-1999
			CZ 20003969 A3	15-08-2001
			EE 200000667 A	15-04-2002
			EP 1078302 A1	28-02-2001
			GB 2351159 A ,B	20-12-2000
			WO 9959036 A1	18-11-1999
			RU 2201613 C2	27-03-2003
			SK 16542000 A3	06-08-2001

PCT/EP 03/06081

**Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK**

## B. RESEARCHIERTE GEBIETE

IPK 7    B42D    G02B    G03H

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

**EPO-Internal**

### C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Beitr. Anspruch Nr.
X	<p>RAI-CHOUDHURY P: "Microlithography, Micromachining and Microfabrication" HANDBOOK OF MICROLITHOGRAPHY, MICROMACHINING, AND MICROFABRICATION. VOL. 1: MICROLITHOGRAPY, BELLIGHAM, SPIE, US, Bd. 1, 1997, Seiten 1-16, XP002251881 ISBN: 0-8194-2378-5 das ganze Dokument</p> <p>----</p>	1-31
A	<p>US 4 576 439 A (KNOP KARL H ET AL) 18. März 1986 (1986-03-18) das ganze Dokument</p> <p>----</p>	1-31
A	<p>GB 2 136 352 A (HOLLUSIONS LIMITED) 19. September 1984 (1984-09-19) das ganze Dokument</p> <p>----</p>	1-31
	<p>----</p> <p>-/--</p>	

**X** Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

**X** Siehe Anhang Patentfamilie

- ° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- \*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

- \*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

- \*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

- \*O\*** Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

- \*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

- \*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist.

- \*X** Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

- \*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

- \* & Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

**Datum des Abschlusses der internationalen Recherche**

15. Oktober 2003

**Absendedatum des internationalen Recherchenberichts**

23/10/2003

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

**Bevollmächtigter Bediensteter**

Daffner, M .

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 42 43 905 A (GAO GES AUTOMATION ORG) 30. Juni 1994 (1994-06-30) das ganze Dokument ---	1-31
A	EP 0 766 103 A (COMMW SCIENT IND RES ORG) 2. April 1997 (1997-04-02) das ganze Dokument ---	1-31
A	US 6 369 919 B1 (DRINKWATER KENNETH JOHN ET AL) 9. April 2002 (2002-04-09) das ganze Dokument -----	1-31



## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationaler Recherchezeichen

PCT/EP 03/06081

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 4576439	A	18-03-1986	AU 558221 B2 22-01-1987
			AU 1895783 A 22-03-1984
			CA 1229006 A1 10-11-1987
			CH 664533 A5 15-03-1988
			DE 3333220 A1 15-03-1984
			ES 282971 U 16-06-1985
			FR 2532966 A1 16-03-1984
			GB 2126949 A ,B 04-04-1984
			IT 1212089 B 08-11-1989
			JP 1670848 C 12-06-1992
			JP 3037233 B 04-06-1991
			JP 59071594 A 23-04-1984
			NL 8303172 A ,B, 02-04-1984
GB 2136352	A	19-09-1984	KEINE
DE 4243905	A	30-06-1994	DE 4243905 A1 30-06-1994
			CN 1091527 A 31-08-1994
			WO 9414621 A1 07-07-1994
			SI 9300679 A 30-06-1994
EP 0766103	A	02-04-1997	AT 208049 T 15-11-2001
			AT 201512 T 15-06-2001
			AU 3993197 A 15-01-1998
			AU 673100 B2 24-10-1996
			AU 7342194 A 28-02-1995
			WO 9504948 A1 16-02-1995
			CA 2168772 A1 16-02-1995
			DE 69427308 D1 28-06-2001
			DE 69427308 T2 06-09-2001
			DE 69428901 D1 06-12-2001
			DE 69428901 T2 27-06-2002
			DE 712500 T1 11-09-1997
			DE 766103 T1 11-09-1997
			EP 0712500 A1 22-05-1996
			EP 0766103 A1 02-04-1997
			JP 9502277 T 04-03-1997
			US 6088161 A 11-07-2000
			US 5825547 A 20-10-1998
US 6369919	B1	09-04-2002	AU 735608 B2 12-07-2001
			AU 3839799 A 29-11-1999
			BR 9910476 A 02-01-2001
			CA 2329936 A1 18-11-1999
			CZ 20003969 A3 15-08-2001
			EE 200000667 A 15-04-2002
			EP 1078302 A1 28-02-2001
			GB 2351159 A ,B 20-12-2000
			WO 9959036 A1 18-11-1999
			RU 2201613 C2 27-03-2003
			SK 16542000 A3 06-08-2001